

特定施設(ダイオキシン類対策特別措置法施行令 別表第1及び第2)

(別表第1)大気

番号	特定施設種類
1	焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉(原料の処理能力が1t/h以上)
2	製鋼用電気炉(変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上)
3	亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉、乾燥炉(原料の処理能力が0.5t/h以上)
4	アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する焙焼炉、溶解炉、乾燥炉(焙焼炉、乾燥炉:原料の処理能力が0.5t/h以上、溶解炉:容量が1t以上)
5	廃棄物焼却炉(火床面積が0.5 m ² 以上、又は焼却能力が50 kg/h以上)

(別表第2)排水

番号	特定施設種類
1	硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設
2	カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設
3	硫酸カリウムの製造の用に供する廃ガス洗浄施設
4	アルミナ繊維の製造の用に供する廃ガス洗浄施設
5	担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち廃ガス洗浄施設
6	塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設
7	カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設、廃ガス洗浄施設
8	クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する水洗施設、廃ガス洗浄施設
9	4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供するろ過施設、乾燥施設及び廃ガス洗浄施設
10	2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノン ¹ の製造の用に供するろ過施設及び廃ガス洗浄施設
11	ジオキサジンバイオレットの製造の用に供するニトロ化誘導体分離施設、還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設、還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンバイオレット洗浄施設及び熱風乾燥施設
12	アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設
13	亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する精製施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設
14	担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼炉で処理しないものに限る。))によるものを除く。)の用に供するろ過施設、精製施設及び廃ガス洗浄施設
15	廃棄物焼却炉(火床面積0.5m ² 以上又は焼却能力50kg/h以上)に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設、污水又は廃液を排出する灰の貯留施設
16	廃PCB等又はPCB処理物の分解施設及びPCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設及び分離施設
17	フロン類(CFC及びHCFC)の破壊(プラズマ反応法、廃棄物混焼法、液中燃焼法及び過熱蒸気反応法によるものに限る。)の用に供するプラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設
18	水質基準対象施設から排出される下水を処理する下水道終末処理施設
19	水質基準対象施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設